

Vide ▶ Couches minces PVD ▶ Contrôle d'étanchéité ▶ Plasma



Dépôt de couches minces PVD sur substrats de 200 mm

DP1100



by

allianceconcept

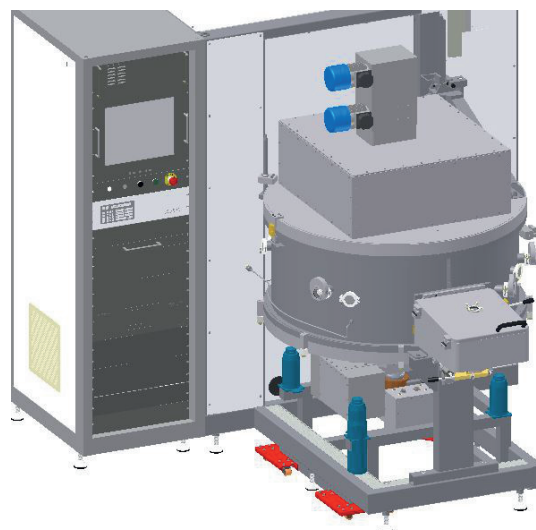
► *Systeme modulaire et évolutif pour tous types de dépôts et matériaux.*

Equipement **versatile à souhait**, le bâti DP1100 propose une chambre circulaire de diamètre 1100 mm. Ce volume permet d'accueillir à titre d'exemple soit **4 sources de 250 mm**, soit **4 sources de 300 mm**.

Bénéficiant des développements communs de notre gamme d'équipement de pulvérisation cathodique, les bâti de la gamme DP font partie de nos produits phare.

Produit à plus de quarante exemplaires autour du monde, la gamme DP est le fer de lance des machines de pulvérisation. Tant développé pour des applications industrielles que sur des thématiques R&D, l'équipement DP1100 sera l'outil adéquat.

Best seller de la gamme PVD, les DP sont des équipements fiables et robustes.



► **Caractéristiques générales**

Diamètre enceinte :	1100 mm
Hauteur :	480 mm
Volume :	Environ 350 litres
Vide limite (configuration turbo + palettes) :	$5 \cdot 10^{-7}$ mbar ^[1]
Vide limite (configuration cryogénique) :	$5 \cdot 10^{-8}$ mbar ^[1]
Capacité machine :	4 positions 300 mm
Uniformité planar :	< +/- 5% ^[1]
Possibilité sas :	Oui
Implantation passe-paroi :	Oui
Pilotage machine :	- Gestion des procédés - Traçabilité

^[1] Ces valeurs sont des valeurs mesurées sur des équipements réalisés et sont données à titre indicatif car sont tributaires de la configuration finale de chaque équipement.

